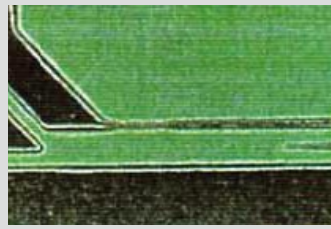


【原因・判断ポイント・発生工程】ネガタイプ A W F と D F R 間の回路線部に介在した長い異物により、浮き上がった A W F 部から回り込んだ露光被りにより出来たもの（露光焼付～ E T 工程）

【原因、判断要点、发生工序】负性 AWF 和 DFR 之间的线路夹杂长的杂物，曝光从浮起的 AWF 漫射而引起的（曝光～ ET 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
A long foreign object exits on a conductor portion between a negative pattern phototool and dry film lifts the phototool, diffracting the exposure light to fog the image, and causes the defect. (Imaging - etching process)



【コメント】
短絡と同居
顕微鏡倍率 × 40

【注釋】
与短路并存
显微镜倍率 × 40

【Comments】
Coexists with short
Magnification: ×40

1-7-2 ET 異常（太り）／ ET 异常（线粗）／ Caused by irregular etching(Expanded copper)

1-7-2-1 ET 過速太り／ ET 太快的线粗／ Expanded conductor by excessive etching-conveyor speed

【特徴】導体全体が片側に裾残りしている太り

【特征】整体导线的单侧有锯齿状的线粗。

【Characteristics】One sides of all the conductors are expanded and tailing.

【原因・判断ポイント・発生工程】E T コンベアスピードが速過ぎた為、コンベア進行方向の反対側の E T が不足気味となって出来たもの（E T 工程）

【原因、判断要点、发生工序】ET 传送速度太快，传送方向的相反侧 ET 有点不足而引起的（ET 工序）。

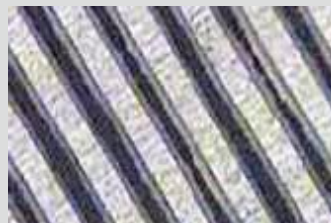
【Causes/processes involved/keys to judgment】
The side of conductor opposite to the moving direction of the etching-conveyor is etched insufficiently due to an excessive conveyor speed, causing the defect. (Etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×